

Figure 1 : Masque de structuration de l'ITO, largeur de l'anode = 100um, résistance de mesure de  $22\Omega$

Pas de résistance de mesure pour 1a (1 accès pour mesure 1 port au VNA) et 1b (2 accès pour mesure 2 ports au VNA)

Existe aussi pour les largeurs d'anode de 50um, 25um et 10um, soit un total de quatre masques de ce type qui diffèrent par la largeur de l'anode.

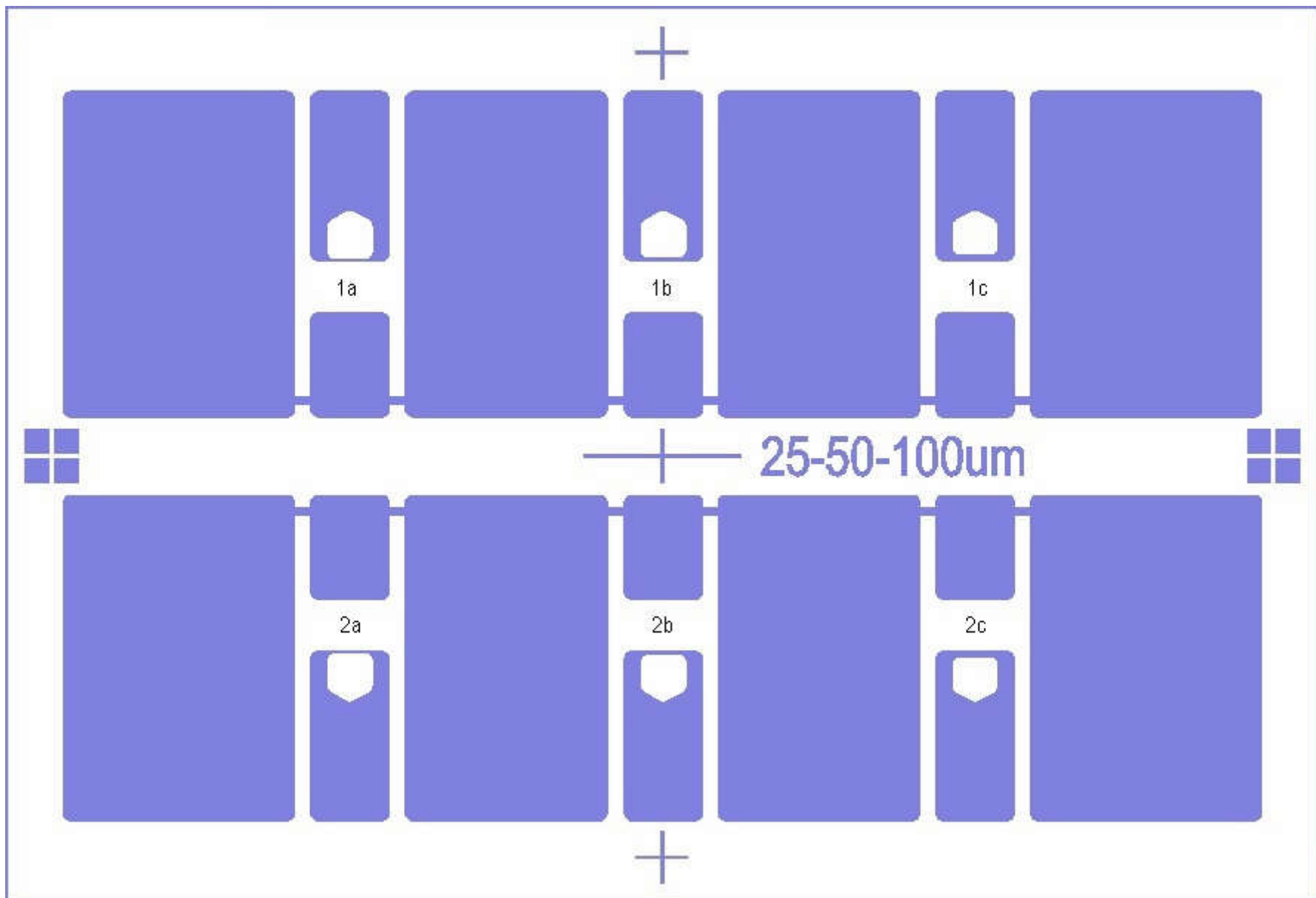


Figure 2 : Masque de structuration de l'ITO, résistance de mesure =  $22\Omega$ , 3 largeurs d'anode = 25 $\mu\text{m}$  (1a et 2a) – 50 $\mu\text{m}$  (1b et 2b) - 100 $\mu\text{m}$  (1c et 2c).

Existe aussi pour la résistance de mesures de  $11\Omega$ , soit un total de deux masques de ce type qui diffèrent par la résistance de mesure

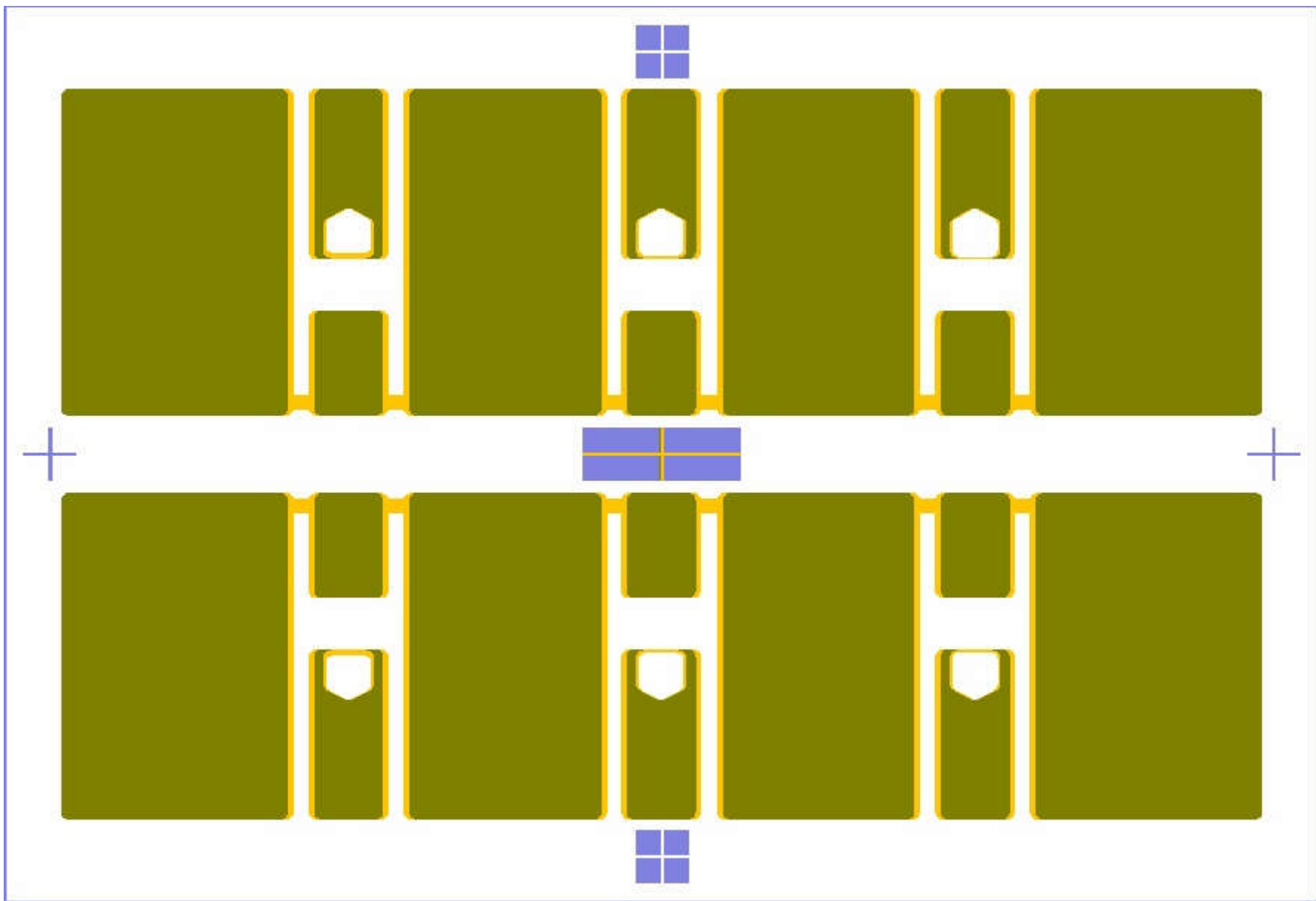


Figure 3 : Masque de métallisation pour résine négative

Sous le masque, en orange, l'ITO gravé. Au dessus les traces de métallisation

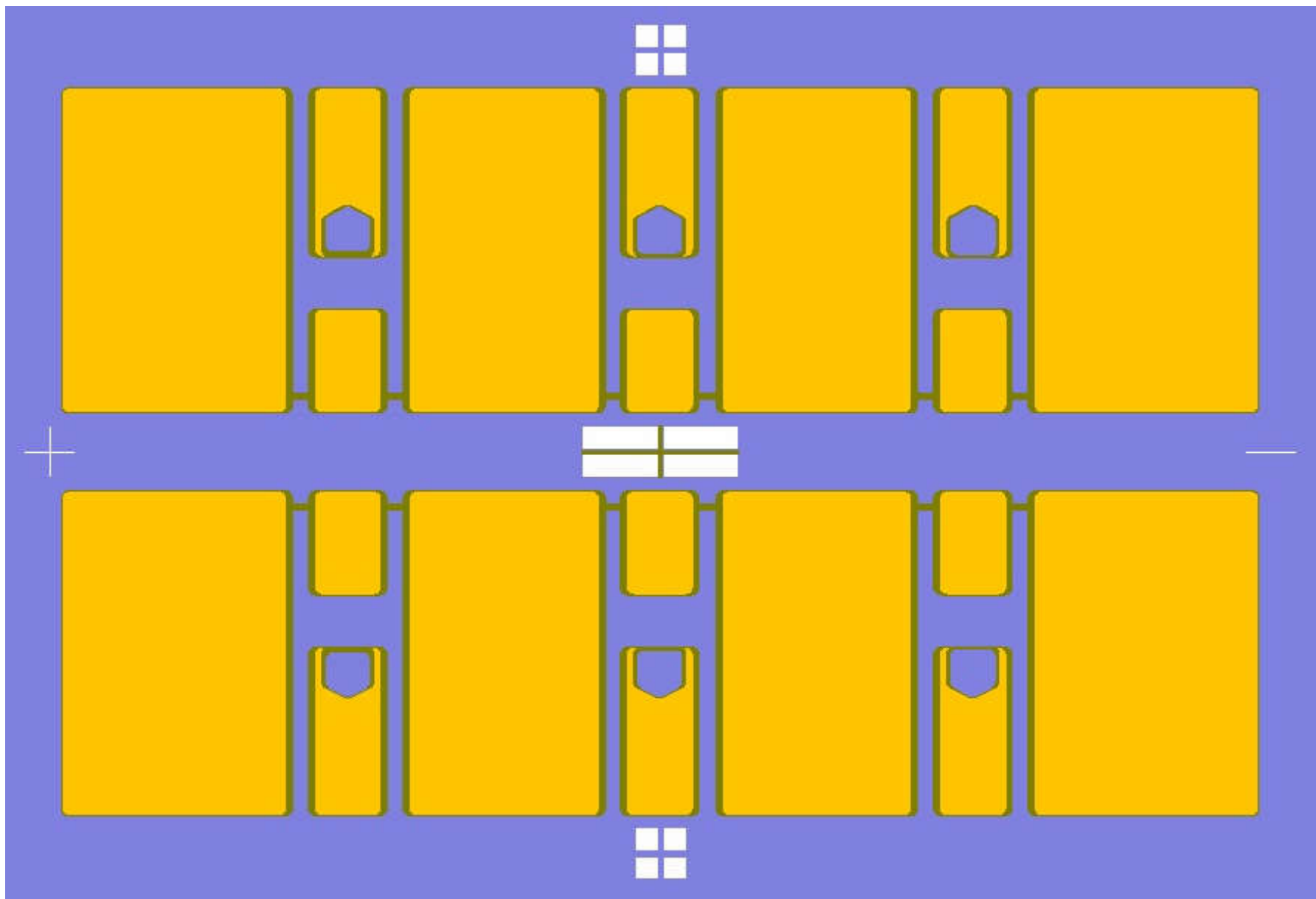


Figure 4 : Masque de métallisation pour résine positive (inverse du masque de la figure 3)

En orange les traces de métallisation et en dessous l'ITO gravé.